Doc. No.: NR250507　　2025年5月7日

令和7年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞を受賞

株式会社SCREENホールディングスはこのほど、令和７年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰において「半導体洗浄技術の開発」の業績で「科学技術賞（開発部門）」を受賞しました。

表彰式の様子
受賞者：シニアフェロー 技術開発担当 田中眞人
☆この画像の印刷用データ（解像度300dpi）は、
下記URLよりダウンロードできます。
（www.screen.co.jp/about/nr-photo_2025）

科学技術分野の文部科学大臣表彰は、科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著な成果を収めた者について、同分野に携わる者の意欲の向上を図り、日本の科学技術水準の向上に寄与することを目的とする表彰です。科学技術賞（開発部門）は、日本の社会経済、国民生活の発展・向上に寄与し、実際に利活用されている画期的な研究開発、発明を行った者に贈られます。

今回の受賞は、半導体需要を背景に急速に進化する半導体デバイスの高集積化に対応し、市場ニーズに応える技術を創出し、半導体研究開発と量産展開に寄与してきたことが評価されたものです。

■ 受賞案件：半導体洗浄技術の開発
■ 受賞者　：シニアフェロー　技術開発担当　田中眞人
■ 受賞内容：
従来から半導体の進化に伴い、ナノオーダーの微細で複雑かつ脆弱な半導体を製造する上で汚染の除去が不可欠でした。本開発では、ウエハー表面の気液界面制御、雰囲気制御、及び構造物にかかる表面張力抑制手段等により、クリーンで均一な洗浄、乾燥時のウォーターマーク抑制及びナノオーダーの高アスペクト構造物の倒壊防止を可能にしました。本開発により、半導体デバイス世代ごとの高集積化に対応する技術を搭載した装置を半導体デバイスメーカーに販売し、半導体の研究開発や量産展開、素子の歩留まり向上に寄与しました。その結果、1980年代は十数億円の事業規模から、半導体需要を背景にCY2024に売上4千億円超の事業へと成長し、今後、さらなる成長が見込まれています。本成果は、コンピューターやスマートフォンをはじめ、データセンターや生成AIの需要増加によって急拡大する半導体市場において、高集積化の一途をたどる最先端半導体の製造に幅広く貢献していきます。

令和7年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰受賞者の決定等について（文部科学省 公式HP）
URL：https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_01503.html

主要特許：特許第3604906号「基板処理装置及び方法」
主要特許：特許第1968310号「基板の洗浄処理方法および装置」

●本件についてのお問い合わせ先
株式会社SCREENホールディングス
経営戦略本部 コーポレートコミュニケーション室 広報部　Tel: 075-414-7131　URL: www.screen.co.jp